# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-149774

(43) Date of publication of application: 02.06.1999

(51)Int.CI.

G11C 11/407 G05F 3/24 G11C 11/413 G11C 11/409

(21)Application number: 10-250187

(71)Applicant: SAMSUNG ELECTRON CO LTD

(22)Date of filing:

03.09.1998

(72)Inventor: YOON SEI-SEUNG

GI SEIMIN

(30)Priority

Priority number : 97 9745862

Priority date: 04.09.1997

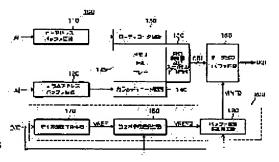
Priority country: KR

# (54) INTEGRATED CIRCUIT SEMICONDUCTOR MEMORY HAVING INTERNAL POWER SUPPLY GENERATOR

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the bandwidth of a memory from decreasing by generating a second reference voltage variable depending on an external power supply voltage and supplying a data output butter with an internal voltage generated based on the second reference voltage thereby preventing a skew from being generated between high and low output voltages by an abnormal external power supply voltage.

SOLUTION: An internal power supply voltage generator 200 generates an internal power supply voltage VINYQ inversely proportional to an external power supply voltage EVC when the external power supply voltage EVC is higher than a specified level, otherwise generates the internal power supply voltage VINTQ proportional to the external power supply voltage EVC. Consequently, a skew is not generated between high and low output voltages in a semiconductor memory 100 due to fluctuation in the external power supply voltage EVC even if an external power supply voltage EVC higher than a normal level is fed to the semiconductor memory 100.



### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

23.04.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-149774

(43)公開日 平成11年(1999)6月2日

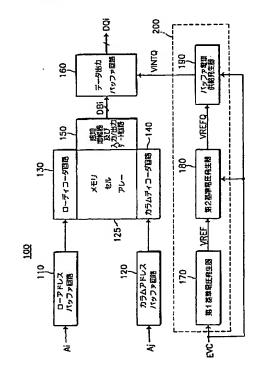
| (51) Int.Cl. <sup>6</sup> | 識別記号                | FΙ                                      |                                |
|---------------------------|---------------------|---|--------------------------------|
| G11C 11/407               |                     | G11C 11/34                              | 354F                           |
| G05F 3/24                 |                     | G05F 3/24                               | В                              |
| G 1 1 C 11/413            |                     | G 1 1 C 11/34                           | 3 3 5 A                        |
| 11/409                    |                     |   | 3 5 4 Q                        |
|                           |                     | 審査請求未請求                                 | : 請求項の数10 OL (全 8 頁)           |
| (21)出願番号                  | <b>特願平10-250187</b> | (71)出顧人 390019<br>三星電                   | 839<br>:子株式会社                  |
| (22)出願日                   | 平成10年(1998) 9月3日    | 大韓民<br>(72)発明者 尹 世                      | 国京 <b>战道</b> 水原市八達区梅雞洞416<br>昇 |
| (31)優先権主張番号               | 1997 45862          | 大韓民国ソウル特別市江南區桃谷洞開浦漢                     |                                |
| (32)優先日                   | 1997年9月4日           | 新エーピーティ 6 -309号                         |                                |
| (33)優先権主張国                | 韓国 (KR)             | (72)発明者 魏 聖▲ミン▼<br>大韓民国ソウル特別市西大門區創天洞503 |                                |
|                           |                     |   |                                |
|                           |                     | -21 •                                   | 15/2                           |
|                           |                     | (74)代理人 弁理士                             | : 志賀 正武 (外1名)                  |
|                           |                     |   |                                |
|                           |                     |   |                                |
|                           |                     |   |                                |
|                           |                     |   |                                |

# (54) 【発明の名称】 内部電源供給発生器を有する集積回路半導体メモリ装置

# (57)【要約】

【課題】 改良された速度と帯域幅を有し、しかも非正常外部電源供給電圧によって発生する高出力電圧と低出力電圧との間にスキューを防ぐことができる集積回路半導体メモリ装置を提供すること。

【解決手段】 第1基準電圧VREFを発生する第1基準電圧発生器170と第2基準電圧VREFQを発生する第2基準電圧発生器180バッファ電源供給電圧として内部電源供給電圧VINTQを発生するバッファ電源供給電圧発生器190で実現された集積回路半導体メモリ装置が提供される。第1と第2基準電圧発生器及びバッファ電源供給電圧発生器には外部電源供給電圧EVCが供給される。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 データを出力するデータ出力バッファ と、

外部電源供給電圧の供給に基づいて内部電源供給電圧を 発生して前記内部電源供給電圧を前記データ出力バッフ ァに提供する内部電源供給電圧発生器とを備えることを 特徴とする集積回路メモリ装置。

【請求項2】 電源供給電圧が所定の電圧以上である場合、内部電源供給電圧が外部電源供給電圧に逆比例することを特徴とする請求項1に記載の集積回路メモリ装置。

【請求項3】 電源供給電圧が所定の電圧以下である場合、内部電源供給電圧が外部電源供給電圧に比例することを特徴とする集積回路メモリ装置。

【請求項4】 データを貯蔵する複数のメモリセルを含むメモリセルアレーと、

貯蔵されたデータを感知して増幅する感知増幅器と、 感知されたデータを受信して前記受信されたデータを外 部に提供するデータ出力バッファと、

第1基準電圧を発生する第1基準電圧発生器と、

外部電源供給電圧に基準に基づいて第2基準電圧を発生 する第2基準電圧発生器と、

前記第2基準電圧に基づいて内部電源供給電圧を発生して、前記内部電源供給電圧を前記データ出力バッファに 提供するバッファ電源供給電圧発生器とを備えることを 特徴とする集積回路メモリ装置。

【請求項5】 外部電源供給電圧が所定の電圧以上である場合、前記第2基準電圧が外部電源供給電圧に逆比例することを特徴とする請求項4に記載の集積回路メモリ装置。

【請求項6】 外部電源供給電圧が所定の電圧以下である場合、第2基準電圧が外部電源供給電圧に比例することを特徴とする集積回路メモリ装置。

【請求項7】 前記第1基準電圧発生器が、

前記第1基準電圧を提供する第1ノードと、

前記外部電源供給電圧に結合された第1端部と前記第1 ノードに結合された第2端部とを有する第1レジスターと、

第2ノードと、

前記第1ノードに結合された第1端部と前記第2ノードに結合された第2端部とを有する第2レジスターと、

前記第2ノードに結合されたドレーンと、ソースと、前記第1ノードに結合されたゲートとを有する第1NMO Sトランジスターと、

前記第1NMOSトランジスターのソースに結合されたドレーンと、第3基準電圧に結合されたソースと、前記外部電源供給電圧に結合されたゲートとを有する第2NMOSトランジスターと、

前記第1ノードに結合されたソースと、第3基準電圧に 結合されたドレーンと、前記第2ノードに結合されたゲ ートと、前記第1ノードに結合された本体とを有する第 PMOSトランジスターとを備えることを特徴とする請 求項4に記載の集積回路メモリ装置。

【請求項8】 前記第2基準電圧発生器が、

前記第2基準電圧を分割された電圧に分割する電圧分割 器と、

前記第1基準電圧と前記分割された電圧とを比較して比較電圧を発生する差動増幅器と、

前記比較電圧に応じて、外部電源供給電圧によって第2 基準電圧を分割するプールアップ分割器とを備えること を特徴とする請求項4に記載の集積回路メモリ装置。

【請求項9】 前記電圧分割器が、

前記分割された電圧を提供するノードと、

前記第2基準電圧に結合されたソースと、前記ノードに 結合されたドレーンと、前記ノードに結合されたゲート と、前記第2基準電圧に結合された本体を有する第1P MOSトランジスターと、

前記ノードに結合されたソースと、前記第3基準電圧に 結合されたドレーンと、前記ノードに結合されたゲート と、前記外部電源供給電圧に結合された本体を有する第 2PMOSトランジスターと、

を備えることを特徴とする請求項8に記載の集積回路メ モリ装置。

【請求項10】 基準電圧を発生する回路において、

上部電源供給電圧を提供する第1ノードと、

下部電源供給電圧を提供する第2ノードと、

入力電圧受信する第3ノードと、

前記基準電圧を提供する第4ノードと、

前記基準電圧を分割された電圧に分割する電圧分割器と、

前記入力電圧と前記分割された電圧とを比較して比較電圧を発生する差動増幅器と、

前記比較電圧に応じて、前記上部電源供給電圧によって 基準電圧を分割するプールアップ分割器とを備え、

前記分割された電圧を提供する第4ノードと、

前記第4ノードに結合されたソースと、第5ノードに結合されたドレーンと、前記第5ノードに結合されたゲートと、前記第4ノードに結合された本体を有する第1PMOSトランジスターと、

前記第5ノードに結合されたソースと、前記第2ノードに結合されたドレーンと、前記第2ノードに結合されたゲートと、前記第1ノードに結合された本体を有する第2PMOSトランジスターとを備えることを特徴とする基準電圧発生回路。

#### 【発明の詳細な説明】

前記電圧分割器が、

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は集積回路半導体メモリ装置に関り、より詳しくは、半導体メモリに使用する ための内部電源供給電圧をデータ出力バッファに供給す る内部電源供給電圧発生器に関するものである。 【 0 0 0 2 】

【従来の技術】DRAMとSRAMのような半導体メモリ装置は集積度が高くなることに従い、データ出力速度と帯域幅が相当改善されてきた。

【〇〇〇3】出力データ保持時間も〇Hと有効出力に対するクロック遅延時間もSACとの間隙(gap)がバーストアクセスモードの重要性によって同期型メモリにおいて重要なパラメータである。これはクロックサイクル時間もCCが間隙に依存するためである。クロックサイクル時間がも〇HともSACとの和と、も〇HともSACとの間隙である。も〇HともSACは上昇を下降遷移時間によって決められ、もSACは下降遷移時間によって決められ、もSACは下降遷移時間によって決められ、もSACは下降遷移時間によって決められ、もSACは下降遷移時間によって決められる。したがって、間隙が大きくなると、クロックサイクル時間は増加され、帯域幅が狭くなる結果になる。も〇HともSACとの間隙の増加は電源供給電圧と温度の変化、或はデータ出力ピンのインビダンス誤整合によって優先的に発生される。間隙は電源供給電圧と温度にきわめて敏感である。

【〇〇〇4】電源供給電圧の変化による七〇日と七SACとの間隙の増加を防ぐため、集積回路半導体メモリ装置上に実現されたデータ出力バッファ回路は外部インタフェースにおける外部電源供給電圧に結合されたデータ出力駆動部の代りに外部電源供給電圧より安定された内部電源供給電圧とデータ出力パットとの間に直列に結合された電流経路を有するプールアップMOSトランジスターと、データ出力パッドと基準電源供給電圧(接地電圧)との間に直列に結合された電流経路を有するプールダウンMOSトランジスターを含む。速度を向上させるため、プールアップMOSトランジスターは内部電源供給電圧によって決められたブーストされた電圧によって供給される。

【〇〇〇5】しかしながら、もし高電源供給電圧が上述したデータ出力バッファ運営管理によって低電源供給電圧半導体メモリに外部的に印加されると、メモリのデータ出力駆動部内のプールアップトランジスターのソースードレーン電圧は増加される。これはプールアップトランジスターの電流駆動能力が増加されたため、高出力電圧と低出力電圧との間にスキュー(skew)を発生する。即ち、上昇遷移時間が短くなり、下降遷移時間は変わらない。結果的に、七〇日が短くなり、七SACは逆に長くなるから、メモリの帯域幅は減少される。

### [0006]

【発明が解決しようとする課題】したがって、本発明の 目的は、改良された速度と帯域幅を有する集積回路半導 体メモリ装置を提供することである。

【0007】本発明の他の目的は非正常外部電源供給電圧によって発生する高出力電圧と低出力電圧との間のス

キューを防ぐことができる集積回路半導体メモリ装置を 提供することである。

【0008】本発明のこの目的と、構成と、特徴は外部電源供給電圧に基づいて内部電源供給電圧を発生して、内部電源供給電圧をデータ出力バッファに提供する内部電源供給電圧発生器を含む集積メモリ装置によって達成される。この望ましい内部電源供給電圧発生器は外部電源供給電圧が所定の電圧(例えば、2.5V)より高いとき、外部電源供給電圧に逆比例する内部電源供給電圧を発生する。一方、内部電源供給電圧は外部電源供給電圧が所定の電圧より低いとき、外部電源供給電圧に比例する内部電源供給電圧を発生する。

【0009】したがって、正常外部電源供給電圧以上高い外部電源供給電圧が半導体メモリに供給されても、本発明による半導体メモリ装置には外部電源供給電圧の変化による高出力電圧と低出力電圧との間にスキューが発生しない。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】本発明の1特徴による と、内部電源供給電圧は第1基準電圧(例えば、1.1 V)を発生する第1基準電圧発生器と、外部電源供給電 圧に依存して変化される第2基準電圧を発生する第2基 準電圧発生器と、第2基準電圧に基づいて内部電圧を発 生して、内部電源供給電圧をデータ出力バッファに提供 するバッファ電源供給電圧発生器を有する。第2基準電 圧発生器は外部電源供給電圧が所定の電圧(例えば、 2.5V)より高いとき、外部電源供給電圧に逆比例す る内部基準電圧を発生する。又、第2基準電圧発生器は 外部電源供給電圧が所定の電圧より低いとき、外部電源 供給電圧に比例する第2基準電圧を発生する。第2基準 電圧発生器は電圧分割器と、差動増幅器と、プールアッ プ分割器で構成される。電圧分割器は第2基準電圧を分 割された電圧に分割する。差動増幅器は第1基準電圧を 分割された電圧と比較して比較電圧を発生する。プール アップ駆動器は比較電圧に応じて外部電源供給電圧によ って第2基準電圧を駆動する。

### [0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の望ましい実施の形態を添付した図面を参照しながら、詳細に説明する。図面では広く公知された回路は本発明の説明を簡単にするため、ブロック図で示し、同一な構成要素には同一な参照番号を付ける。

【0012】図1を参照すると、本発明による集積回路 半導体メモリ装置がブロック図で示している。メモリ装置100はローアドレスAiを受信するローアドレスバッファ回路110と、カラムアドレスAjを受信するカラムアドレスバッファ回路120と、ローとカラムで配列されデータビットを貯蔵する複数のメモリセルと、ローアドレスAiに基づいてメモリセルアレー125のうち1つのローを選択するローディコーダ回路130と、 メモリセルアレー125のうち、少なくとも1つのカラムを選択するカラムディコーダ回路140と、選択されたメモリセルからデータDBiを感知及び増幅する感知増幅器及び入力/出力(I/O)ゲート回路150と、データDBiをI/OパッドDQiを出力するデータ出力バッファ回路160を含む。メモリ装置100は加えて外部電源供給電圧(上部電源供給電圧)EVCに基づいて内部電源供給電圧VINTQを発生する内部電源供給電圧XINTQはデータ出力バッファ160に提供する。

【0013】内部電源供給電圧発生器200は第1基準電圧VREFを発生する第1基準電圧発生器170と、第2基準電圧発生器VREFQを発生する第2基準電圧発生器180と、バッファ電源供給電圧として内部電源供給電圧VINTQを発生するバッファ電源供給電圧発生器180とを含む。第1と第2基準電圧発生器170と180バッファ電源供給電圧発生器190は外部電源供給電圧EVCを供給する。

【0014】図2はデータ出力バッファ160の詳細回 路構成を示している。データ出力バッファ160はNA NDゲートG1, G2, 及びG3と、インバータIV1 及びIV3と、ブスティング回路162と、出力駆動回 路164とを含む。第1NANDゲートG1は感知増幅 器とI/Oゲート回路150からデータ信号DBiを受 信する第1入力と、内部制御回路(図示しない)と、入 力信号DBiとPTRSTのNANDゲート論理出力信 号を提供する出力を含む。第1インバータ I V 1はデー 夕信号DBiと反転された信号DBiバーとを受信する 入力を有する。第2インバータ I V 2はインバータ I V 1から反転された信号DBiバーを受信する第1入力 と、制御信号PTRSTを受信する第2入力と、入力信 号DBiバーとPTRSTのNAND論理出力信号を提 供する出力とを有する。第2インバータ I V 3 は第2 N ANDゲートG2の出力に結合された入力と、出力駆動 回路164に結合された出力を有する。ブスティング回 路162は第1NANDゲートG1の出力に結合された 入力を有するインバータ I V 2と;インバータ I V 2の 出力に結合された第1電極を有する電荷ポップキャパシ ターC1と;ダイオド接続されたNMOSトランジスタ MN9を経て内部電源供給電圧VINTQに結合された 第2電極と、キャパシタC1の第2電極とダイオド接続 されたトランジスターMN9と共通に接続されたソース と、出力駆動回路164に結合されたドレーンと第1N ANDゲートG1に結合されたゲートを有するプールア ップPMOSトランジスターMN10と;プールアップ トランジスターMP10のドレーンに接続されたドレー ンと、基準或は下部電源供給電圧(即ち、接地電圧)G NDに接続されたソースと、第3NANDゲートG3の 出力に結合されたゲートを有するプールダウンNMOS トランジスター出力駆動回路164は外部電源供給電圧 EVCに接続されたドレーンと、出力パッドDOUTに結合されたソースと、ブスティング回路162内にトランジスターMP10とMN10のドレーンに結合されたゲートと;出力パットDOUTに結合されたドレーンと、基準電源供給電圧GNDに結合されたソースと、インバータIV3の出力に結合されたゲートを有するプールダウンNMOSトランジスターMN12を含む。この構成の出力バッファ回路の動作は以下詳細に説明する。【0015】データ信号DBiが高論理レベルであり

(或は反転されたDBiバーが低論理レベルである)制 御信号PTRSTが高論理レベルであるとき、第1と第 3NANDゲートG1とG3の出力信号は低論理レベル になり、第2NANDゲートG2の出力信号は高論理レ ベルになる。ブスティング回路162において、(第1 プールダウンアップトランジスターと称した) プールダ ウントランジスターはタンオフされる。結果として、電 荷ポンプキャパシタC1は第1プールアップトランジス ターMP10を経て所定のブーストされた電圧(例え ば、約VINTQx1.8V)を第1プールアップノー ドDOK或は出力駆動回路164内の(第2プールアッ プトランジスターと称した) プールアップトランジスタ -MN11のゲートに提供する。ノードDOKのブース トされた電圧は有利な速度を提供し、内部電源供給電圧 VINTQに依存する。このとき、低論理レベルはプー ルアップノードDOKバー或いは出力駆動回路164内 の (第2プールダウントランジスターと称した) プール ダウントランジスターMN12に提供されるため、第2 プールダウントランジスターMN12はタンオフされ る。従って、ノードDOKの電圧レベルは電荷ポンプキ ャパシタによるポンピング電位とインバータIV2を通 じる電位の和であるから、第2プールアップトランジス ターMN11はタンオンされ、出力パッドDOUTの電 圧レベルは高論理レベルになる。

【0016】一方、データ信号DBiは低論理レベル(或いは反転されたデータ信号DBiバーは低論理レベル)であり、制御信号PTRSTが高論理レベルである時、第1と第3NANDゲートG1とG3の出力信号は高論理レベルになり、第2NANDゲートG2の出力信号は低論理レベルになる。したがって、第1プールアップトランジスターMP10はタンオフされ、第2プールダウントランジスターMN10はタンオンされ、第2プールダウントランジスターMN12はタンオンされる。結果的に出力パットDOUTの電圧レベルは低論理レベルになる。

【0017】しかしながら、正常電源供給電圧レベルLEVC以上の高外部電源供給電圧HEVC(例えば、2.5V)は上述した構成の半導体メモリ装置に供給され、ノードDOKは本発明の前記従来の技術部分に述べたように外部電源供給電圧変化に関わらず、殆ど一定な所定のブーストされた電圧で供給され、第2プールアッ

プトランジスターMN11の電流駆動能力(或いは電導度)は正常状態にトランジスターMN11の電流駆動能力により低くなる。結果的に、図6に示したように基準記号AとBが正常状態の時、高と低出力電圧を示し、記号A、は非正常状態の時、高出力電圧を示しているところで外部電源供給電圧の変化によって、電圧出力高電圧VOHと出力低電圧VOLとの間のスキューが発生される。従って、そのスキューの発生を防ぐのが必要である。この解決方法は以下で説明する内部電源供給電圧発生器200にある。

【0018】図3は第1基準電圧発生器170の詳細な 回路構成を示している。第1基準電圧発生器170はレ ジスタR1とR2と、NMOSトランジスターMN1と MN2と、PMOSトランジスターMP1とで構成され る。レジスターR1の一端部は外部電源供給電圧(上部 電源供給電圧) EVCに結合され、その他の端部は第1 基準電圧VREFを提供する第1ノード14に結合され る。レジスタR2の一端部は第1ノード14に結合さ れ、その他の端部は第2ノード16に結合される。NM OSトランジスターMN1TOとMN2は第2ノード1 6と基準電圧(下部電源供給電圧) GNDとの間に直列 に結合されたソースードレーン導電経路(即ち、チャン ネル)を有する。NMOSトランジスターMN1とMN 2のゲートは第1ノード14と外部電源供給電圧EVC に各々結合される。PMOSトランジスターMP1は第 1ノード14に結合されたソースと、接地電圧GNDに 結合されたドレーンと、第2ノード16に結合されたゲ ートと、第1基準電圧VREFに印加された本体(或い はバルク)とを有する。

【0019】第1基準電圧VREFはPMOSトランジスターMP1のスレショルド電圧 $V_{tp1}$ とNMOSトランジスターMN1のドレーン電圧 $V_{DN1}$ との和である。第1基準電圧VREFは以下のように表示できる。

 $VREF = V_{IP1} + V_{DN1}$ 

- $= V_{TP1} + (V_{TP1}/R2) R_{TR}$
- $= V_{TP1} + (1 + R_{TR}/R2)$

ここで、 $R_{IR}$ はNMOSトランジスターMN1とMN2の等価抵抗値の和である。

【0020】この方程式から、外部電源供給電圧EVCは第1基準電圧TVREFを発生する回路170に影響を与えないことを認識しなければならない。スレショルド電圧 $V_{TP1}$ が温度に逆比例し、抵抗値の和 $R_{TR}$ が温度に比例するため、基準電圧の温度変化の影響は最小化される。

【0021】図4を参照すると、第2基準電圧発生器180の詳細回路構成を示している。第2基準電圧発生器180は差動増幅器212と、プールアップ駆動器214と、電圧分割器216とを含む。差動増幅器212はPMOSトランジスターMP2とMP3によって形成される電流ミラー(current mirror)と、

NMOSトランジスターMN3とMN4によって形成さ れた差動対と、NMOSトランジスターMN5によって 形成された電流シンカー(current sinke r)で構成される。電流ミラーMP2とMP3には外部 電源供給電圧EVCが供給される。トランジスターMP 2とMP3の本体は外部電源供給電圧EVCに結合され る。第1基準電圧VREFはトランジスターMN3とM N5のゲートに印加される。トランジスターMN4のゲ ートは電源分割器216に結合される。出力ノード17 はプールアップ分割器214に結合される。差動増幅器 212は第1基準電圧VREFを分割器216の分割さ れた電圧Vdivと比較して、比較電圧Scompを発 生する。分割された電圧Vdivが第1基準電圧VRE Fより低いとき、比較電圧Scompは減少され、第2 基準電圧VREFQを増加させる。反面、分割された電 圧Vdivが第1基準電圧VREFより高いとき、比較 電圧Scompは増加され、第2基準電圧VREFQを 減少させる。プールアップ駆動器214はゲートがノー ド17に結合されたPMOSトランジスターMP4を含 む。トランジスターMP4のソースードレーンチャンネ ルは第2基準電圧VREFQを提供するために、外部電 源供給電圧EVCとノード18との間に結合される。プ ールアップ駆動器214は外部電源供給電圧EVCによ って第2基準電圧を駆動する。電圧駆動器216はノー ド18と接地電圧GNDとの間に直列に結合された2つ の抵抗器-接続PMOSトランジスターMP5とMP6 で構成される。トランジスターMP5とMP6の接合ノ ード19は差動増幅器212内のトランジスターMN4 のゲートに結合される。トランジスタMP5の本体は外 部電源供給電圧EVCに結合される。電圧分割器216 は第2電圧VREFQを電圧Vdivで分割される。こ の電圧Vdivはノード19を経て差動増幅器212に

【0022】正常外部電源供給電圧以上の外部電源供給電圧が本発明の半導体メモリチップに供給されるとき、分割器回路216内のPMOSトランジスターMP6のスレショルド電圧V<sub>TP6</sub>が増加され、分割された電圧Vdivが増加されるようにする。結果的に、正常外部供給電圧(例えば、2.5V)以上の外部電源供給電圧が本発明のメモリに供給されると、図7に示したように分割された電圧Vdivが比較的に増加され、第1基準電圧VREFが一定(例えば、1.1V)に維持されるから、第2基準電圧VREFQが減少される。

【0023】図5はバッファ電源供給電圧発生器190の詳細回路構成を示している。バッファ電源供給電圧190は差動増幅器230と、プールアップ駆動器232と、データ出力バッファ160に内部電源供給電圧VINTQを提供する出力ノード234を含む。差動増幅器230はPMOSトランジスターMP7とMP8によって形成される電流ミラーと、比較電圧を提供する出力ノ

ード50と、NMOSトランジスターMN6とMN7に よって形成された差動対と、NMOSトランジスタMN 8によって形成された電流シンカーとを含む。電流ミラ ートランジスターMP7と8は外部電源供給電圧EVC で供給される。トランジスターMP7とMP8の本体は 外部電源供給電圧EVCに結合される。第基準電圧VR EFQはトランジスタMN6のゲートに結合され、内部 電源供給電圧VINTQはトランジスターMN7のゲー トに結合される。電流シンカートランジスターMN8は 内部制御回路(図示しない)からの制御信号PVINT QEに供給される。プールアップ駆動器214はゲート がノード50に結合されたPMOSトランジスターMP 9を含む。トランジスターMP9のソース-ドレーンチ ャンネルは外部電源供給電圧EVCとノード234との 間に結合される。プールアップ駆動器214は外部電源 供給電圧EVCを使用して内部電源供給電圧VINTQ Qを駆動する。

【0024】内部電源供給電圧VINTQが第2基準電 EVREFQより低いとき、ノード50の比較電圧は減 少され、内部電源供給電圧VINTQが増加する。反 面、内部電源供給電圧VINTQが第2基準電圧VRE FQより高いとき、ノード50の比較電圧は増加され、 内部電源供給電圧VINTQが減少する。

#### [0025]

【発明の効果】従って、正常外部電源供給電圧以上の外部電源供給電圧が本発明の半導体チップに供給される時、第2基準電圧VREFQが減少され、第2プールアップトランジスターMN11の第2プールアップトランジスターMN11のゲートーソース電圧Vgsが減少される(図6参照)ようになるから、内部電源供給電圧VINTQは相対的に減少される。これは高EVCによって発生されたドレーンーソース電圧Vdsの増加を補償

し、トランジスターMN11は外部電源供給電圧にもかかわらず、一定な電流駆動能力を有して、外部電源供給電圧の変化による高出力電圧VOHと低出力VOLとの間のスキューの発生を防ぐことができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明による半導体メモリ装置の実施の形態を示すブロック図である。

【図2】 図1に示したデータ出力バッファの詳細な回路図である。

【図3】 図1に示した第1基準電圧発生器の詳細な回路図である。

【図4】 図1に示した第2基準電圧発生器の詳細な回路図である。

【図5】 図1に示したバッファ電源供給電圧発生器の 詳細な回路図である。

【図6】 外部電源供給電圧の変化による高出力電圧と てい出力電圧との間にスキューを示した図である。

【図7】 外部電源供給電圧と第2基準電圧発生器との 関係を示した図である。

#### 【符号の説明】

100:半導体メモリ装置

110:ローアドレスバッファ回路

120:カラムアドレスバッファ回路

125:メモリセルアレー

130:ローディコーダ回路

140:カラムディコーダ回路

150:入力/出力ゲート回路

160:データ出力バッファ回路

170:第1基準電圧発生器

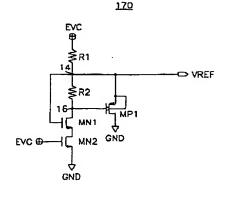
180:第2基準電圧発生器

190: バッファ電源供給発生器

200:内部電源供給電圧発生器

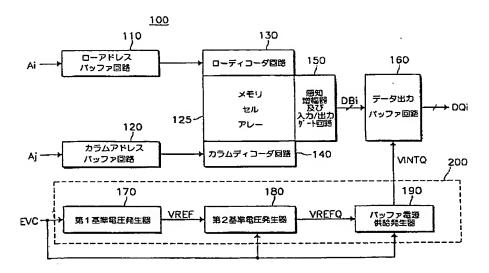
【図2】

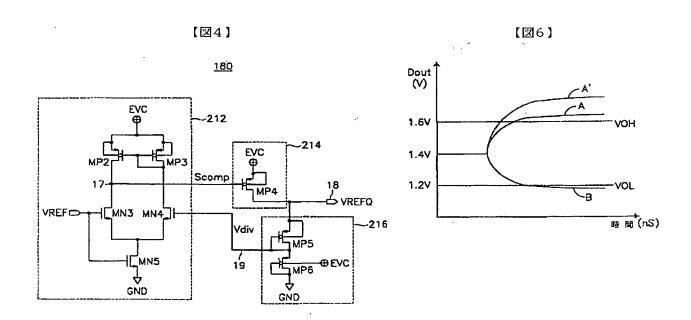
<u>160</u> -162 VINTO MN9 Dai co -164 FVC C1 45мР10 р<u>ок</u> IĽMN11 N1 רואאוס C DOLT DBi DOK KW12 CND PTRST



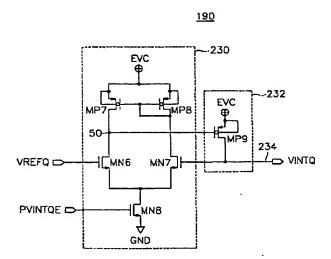
【図3】

【図1】





【図5】



# 【図7】

